

اثر آلاینده کروم روی خواص الکترونی بلور تیتانات استرانسیم

مولاروی، طبیه

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شهرورد

چکیده

در این پژوهش چگالی حالت های جزئی و کلی بلور تیتانات استرانسیم ($Sr_{0.875} Cr_{0.125} TiO_3$) و آلیاز ($SrTiO_3$) در فاز مکعبی مطالعه شده است. اثر ناخالصی کروم روی خواص الکترونی این بلور مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات با روش پتانسیل کامل امواج تخت تقویت شده خطی (FP-LAPW) در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT)، با تغیری شب تعمیم یافته (GGA) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که هیبرید اسیونی قوی بین تراز $d3$ اتم تیتانیم باحالت های $2p$ اکسیژن و همچنین بین اریتال های $4p$ اتم استرانسیم با $2s$ اتم اکسیژن وجود دارد. بلور تیتانات استرانسیم دارای گاف انرژی حدود 1.85 eV باشد در حالیکه با افزایش آلاینده کروم، یک گذار عایق به فلتر در ترکیب $Sr_{0.875} Cr_{0.125} TiO_3$ مشاهده می شود.

Effect of Cr Doping on Electronic Structure of $SrTiO_3$ Crystal

Movlarooy, Tayebeh

Department of Physics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

Abstract

In this work the partial and total density of states (PDOS, DOS) of $SrTiO_3$ crystal and $Sr_{0.875} Cr_{0.125} TiO_3$ compound have been studied in cubic phase. The effect of Cr doping on electronic properties of this crystal has been investigated. The calculations have been performed using the full-potential-linearized augmented-plane wave method (FP-LAPW) within the framework of density functional theory (DFT), with generalized gradient approximation (GGA). The results revealed that there is strong hybridization between $Ti-3d$ and $O-2p$, and also between $Sr-4p$ and $O-2s$ orbitals. The $SrTiO_3$ crystal has a band gap of about 1.85 eV while seen an insulator-to-metal transition by Cr doping, in the $Sr_{0.875} Cr_{0.125} TiO_3$ compound.

ترکیب در دماهای کمتر از 105 K به شکل چهارگوشی درمی آید. تیتانات استرانسیم از جمله مواد نافروالکتریک با ضربی شکست و ثابت دی الکتریک بالا، پایداری گرمایی و شیمیایی خوب، فعالیت نوری قابل قبول، و ظرفیت ذخیره بار بالاست [۱-۲]. تیتانات استرانسیم آلاینده با کروم به دلیل گذار عایق-فلز و همچنین نقش ظرفیتی کروم در هدایت و رفتار سوئیچینگ کاربردهای زیادی به عنوان حافظه های مقاومتی دارد [۳-۷]. در شکل ۱ یاخته بسیط بلور

مقدمه

در چند دهه اخیر لایه های اکسیدی پروسکایت با ثابت دی-الکتریک بالا توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. این اکسیدها در ساخت خازن، حافظه های دینامیکی قابل دسترس گستره ای، وسایل الکتروپاتیکی و نمایشگرهای الکتروولولیانی کاربرد دارند. تیتانات استرانسیم ($SrTiO_3$) ماده ای پارالکتریک است که در دمای اتفاق ساختار بلوری پروسکایت مکعبی دارد. ساختار این